

電子ビームリソグラフィセミナーV

筑波大学、物質・材料研究機構、東京工業大学、産業技術総合研究所は、文部科学省委託事業である「ナノテクノロジープラットフォーム」の一環として「電子ビームリソグラフィセミナーV」を筑波大学東京キャンパスにて開催いたします。電子ビームリソグラフィ技術に関わる最新レジストプロセスからデータ補正技術、微細パターン形成の露光事例について紹介いたします。また、各セッションの終わりにオーサーズ・インタビューの時間を設けました。普段質問しづらいことを、この機会に是非、講師の先生方に個別にご質問ください。産学官にかかわらず、多くの皆様のご参加をお待ちしています。

【日時】令和元年11月27日（水）12:55～16:35

【場所】筑波大学東京キャンパス文京校舎 119号教室（丸ノ内線茗荷谷駅）

http://www.tsukuba.ac.jp/access/bunkyo_access.html

【参加費】無料

【定員】90名(先着順、参加登録をお願いします)

【セミナー案内/申し込み】

<https://www.tia-kyoyo.jp/npf/seminar/2019-2/>

【講演プログラム】

12:55-13:00 はじめに

産業技術総合研究所 多田哲也

13:00-13:40『新規レジスト材料開発のための設計戦略』

大阪大学産業科学研究所¹、日本ゼオン株式会社²

中島綾子¹、星野学²、橋本昌和²、古澤孝弘¹

13:40-14:20『光集積回路作製を目的とした厚膜レジストへの電子ビーム露光

近接効果補正技術』

東京工業大学 西山伸彦

14:20-14:50『レジスト現像シミュレーションから見る電子ビーム近接効果とその補正』

GenISys株式会社 清水 諭

14:50-15:05 休憩（オーサーズインタビュー）

15:05-15:35『大面積偏向型超高速電子ビーム描画装置について』

株式会社エリオニクス 新関 嵩

15:35-15:55『電子ビーム露光装置を用いたGa₂O₃ FinFETとAlN光導波路の作製』

筑波大学 奥村 宏典

15:55-16:15『電子ビーム描画条件最適化のための実験的検証』

物質・材料開発機構 NIMS微細加工プラットフォーム 大里 啓孝

16:15-16:35『ポジ・ネガ反転パターン形成のためのDDRプロセス』

産総研 ナノプロセッシング施設 郭 哲維

17:00～18:30意見交換会（無料） TAMAYA（筑波大学東京キャンパス正門前）

主催：産業技術総合研究所ナノプロセッシング施設（NPF）

主催：物質材料研究機構微細加工プラットフォーム

主催：筑波大学微細加工プラットフォーム

主催：東京工業大学 科学技術創成研究院未来産業技術研究所

共催：ナノエレクトロニクス計測分析技術研究会（TSC）

協賛：GenISys株式会社

協賛：株式会社エリオニクス

電子メール：tia-npf-school2@aist.go.jp

